急速熱処理 L10- FePt 形成における窒化膜下地の Fe dead 層低減効果

三吉啓介¹⁾,田中万裕¹⁾,二川康宏¹⁾,塚本新²⁾

日本大学大学院理工学研究科¹⁾,日本大学理工学部²⁾

Reduction of Fe dead layer with nitrided under layer in formation of $L1_0$ - FePt fabricated by Rapid Thermal Annealing K. Miyoshi¹, M. Tanaka¹, Y. Futakawa¹, and A. Tsukamoto²

Graduate School of Science and Technology Nihon Univ.¹⁾, College of Science and Technology, Nihon Univ.²⁾ はじめに

高密度磁気記録媒体作製に向けて, 我々は平坦な熱酸化 Si 基板上 Pt/Fe 多層薄膜に対し, 急速昇降温熱処 理(Rapid Thermal Annealing: RTA, Rapid Cooling Process: RCP)のみを施すことより L1₀-FePt ナノ磁性微粒子 群の形成を報告している¹⁾. また初期積層膜厚 1.88 nm, 積層組成比 Fe₆₂Pt₃₈にて形成した微粒子群は基板面垂 直方向に 40 kOe 以上の高い保持力 H_cを示しており, Fe-熱酸化 Si 界面における磁性に寄与しない Fe dead 層 の存在により Fe の実効的組成が減少方向へシフトしたことが考えられる²⁾. そこで Fe dead 層の低減を図り, 酸素を含まず, かつ RTA 過程での熱的条件への影響の少ない材料として, 窒化物であり比熱, 熱伝導率等の 熱物性が SiO₂ とほぼ同等である SiN 下地層を選択した. 形成する FePt 粒子の形態及び磁気特性から Fe dead 層の低減についての検討を報告する.

<u>実験方法</u>

平坦な熱酸化 Si 基板上に DC・RF マグネトロンスパッタ法により積 層組成比 Fe₅₀Pt₅₀ として Pt (1.06 nm)/Fe (0.82 nm)/SiN (t nm)/sub. ((a) t = 0, (b) 5, (c) 60, (d) 120)の膜構成で積層した.これらの薄膜に対し, 真空炉にて赤外線ランプ光照射による目標到達温度約 700 ℃まで約 180 ℃/sec.の RTA, 直後 N₂ガス流入による RCP を施した.作製した試 料の観察に透過型電子顕微鏡(Transmission Electron Microscope: TEM), 磁化曲線の測定に振動試料型磁力計を用いた.

<u>実験結果</u>

形成した粒子の形態には大きな下地依存性が見られた.Fig.1に(a)-(d)の条件にて作製した各試料の面内明視野 TEM 像と平均粒径 D_a, 粒子 数密度 N_pを示す.(a),(b)にて孤立ナノ微粒子群の形成を確認した.(c),(d) にて粒子同士が結合した形態,(d)においては網目状構造を確認した.Fig. 2 に(a)-(d)で作製した各試料の室温における基板面垂直方向への磁場印 加条件の磁化曲線,Fig.3 に得られた磁化曲線の飽和磁化 M_s,保磁力 H_c を示す.Fig.2,3 から,SiN 下地を用いることにより FePt の M_sが増大する 傾向を示した.よって Fe-熱酸化 Si 界面における Fe dead 層が SiN 下地 を用いることで減少し,低減効果の存在が示唆された.また SiN 下地の 導入により,表面モルフォロジーに大きな変化を生じた.これは界面状 態の変化を示唆するものと考えられる.一方,いずれの試料においても L1₀-FePt に起因し発現したと考えられる高い H_cを示したが,(d)は相対 的に著しく減少した.(d)は粒子結合した網目状構造であり,磁壁移動を 含む磁化反転モードに変化し H_cが減少したものと考えられる.

<u>謝辞</u>

本研究の一部は情報ストレージ研究推進機構の助成および文部科学 省私立大学戦略的研究基盤支援事業 (S1311020)の助成により行った.

<u>参考文献</u>

1) A. Itoh, A. Tsukamoto, S. Okame and K. Mizusawa: J. Magn. Soc. Jpn. 36, 62-65(2012).

2) Masayuki Imazato, Aki Ogasaara, and Arata Tsukamoto: MORIS2015, Penang, Malaysia, Tu-P-12, (2015).

 (a) t = 0 (b) t = 5

 20 nm
 $D_a: 13.2$ 20 nm
 $D_a: 26.7$
 $N_P: 0.90$ 20 nm
 $D_a: 26.7$ $N_P: 0.26$

 (c) t = 60 (d) t = 120

 20 nm
 $D_a: 14.6$ $D_a: N_P: 0.47$ 20 nm
 $D_a: -$

Fig. 1 TEM planer view images of FePt (a) on SiO_x, (b) - (d) on SiN(t = 5, 60, 120 nm), average FePt grain diameter D_a nm, and areal density of grains N_p T particles / inch².



-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50Magnetic field H(kOe)Fig. 2 M-H loops of FePt (a) on SiO_x, (b) - (d) on SiN(t = 5, 60, 120 nm) at 300 K.



Fig. 3 Saturation Magnetization M_s and Coercive Force H_c of FePt (a) on SiO_x, (b) - (d) on SiN(t = 5, 60, 120 nm).